

عنوان مقاله:

سنتر و مشخصه یابی لایه نازک اکسید مس رشد یافته به روش کندوپاش واکنشی

محل انتشار:

بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 7

نویسندگان:

خدیجه فرهادیان - دانشکده مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل (دانشجوی کارشناسی ارشد نانو مواد)

مرضیه عباسی فیروزجاه - دانشکده مهندسی، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار، سبزوار (استادیار)

مجید عباسی - دانشکده مواد و صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل (دانشیار)

مجتبی هاشم زاده - دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود (استادیار)

خلاصه مقاله:

در این پژوهش لایه اکسید مس به روش کندوپاش واکنشی بر روی زیرلایه های شیشه ای در توان های مختلف لایه نشانی شده اند. به منظور بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه ها به ترتیب از روش های مشخصه یابی پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف سنجی UV-Vis استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش توان، فاز اکسید مس (Cu_2O) به فاز کریستالی مس تغییر پیدا می کند. با بررسی خواص اپتیکی، گاف انرژی اکسید مس 2/58eV مشخص شده است.

کلمات کلیدی:

کندوپاش، اکسید مس، گاف انرژی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1013809>

